J-PARC RCS のレーザー荷電変換入射の可能性

山根 功*1·原田 寬之*2·Saha PRANAB*2·加藤 新一*2

Feasibility Study on Laser Stripping Injection for J-PARC RCS

Isao YAMANE^{*1}, Hiroyuki HARADA^{*2}, Saha PRANAB^{*2} and Shinichi KATO^{*2}

Abstract

Feasibility is studied on the laser stripping injection of H⁻ beam for J-PARC RCS. The injection energy is 400 MeV and the repetition frequency of H⁻ micro-bunch is 324 MHz. Major hurdles to be cleared are as follows. Because necessary magnetic field for the Lorentz stripping of H⁻ ion and the 2nd excited state of H⁰ atom is no less than about 2 T and too high to install in the injection area. Therefore, photo-detachment using Nd:YAG laser is to be adopted. Because the Doppler effect is weak at 400 MeV, an excimer laser is necessary in order to excite H⁰ atom from ground state to the 2nd excited state, whose excitation energy is 12.1 eV. Because the momentum spread of the H⁰ beam is $\sim 10^{-3}$, the laser band width in the particle rest frame is broadened by the Doppler effect and the necessary laserpulse energy is accordingly increased. In order to supply necessary laser-beam pulse in 324 MHz, a laser-storage ring is to be developed.

1. はじめに

H⁻イオンには二つの電子が結合しているが, この内の一つの結合は緩く,比較的容易に剥離し H⁰原子とすることが出来る.しかしH⁰原子の基 底状態にある電子の結合は極めて強く容易に剥離 することは出来ない.400 MeV H⁻ビームをリン グ加速器に荷電変換入射する場合,次章で詳述す るように,H⁰原子の電子を直接あるいは一旦第 一または第二励起状態に励起した上で剥離するこ とが必要になる.この時H⁰原子の静止系で 10 eV 程度以上のエネルギーの光子が必要であ る.実験室系では Doppler 効果によりこの光子 のエネルギーはわずかに低くなるが,これを供給 するレーザーとしてエキシマレーザーが必要であ る.

通常使われているエキシマレーザーは希ガスと ハロゲンガスの混合気体を放電させエキシマーを 作る.放電に注入するエネルギー密度は極めて高 く,放電ガスの急速な劣化を緩和するためガス循 環装置や冷却系を放電室に装備する.このため レーザー装置は大きくなる. J-PARC RCS では, LINAC から供給される 324 MHz のH⁻ビームマ イクロバンチにレーザーパルスを衝突させるため にレーザー蓄積リングが必要となる. このレー ザー蓄積リングにエキシマレーザー装置を組み込 むことは困難であると考えられ, J-PARC RCS で のレーザーストリッピング入射は無理であろうと 思われた.

最近 J-PARC RCS ではカーボンフォイル荷電 変換入射により1 MW 相当のビーム出力を 0.4 Hz の遅い繰り返しで達成した. 今後,所期 設計の25 Hz の速い繰り返しにし,フォイル周 辺の放射化やフォイル寿命など継続して観測する 必要はあるが1 MW 出力程度は実験データより 許容できる可能性が高い. これに伴い,ビーム強 度を数 MW に増強する場合のフォイル入射によ るフォイル周辺の放射化の問題やフォイル寿命の 限界が意識されるようになり,レーザーストリッ ピングの可能性について検討されるようになっ た. これを契機にエキシマレーザーについても再 度詳細な検討を行った. 以下の章では,放電励起

*1 高エネルギー加速器研究機構 KEK, High Energy Accelerator Research Organization
 高エネルギー加速器研究機構 名誉教授 ダイヤモンドフェロー
 (E-mail: yamane@post.kek.jp)

^{*2} 日本原子力研究開発機構 JAEA, Japan Atomic Energy Agency

エキシマレーザーや電子ビーム励起エキシマレー ザーをレーザー蓄積リングに搭載する可能性につ いて検討した結果を記述する.

次世代の数 MW 陽子ビームの時代を切り拓く ためには、フォイルに代わる荷電変換媒体が必要 である.やはりレーザーはその本命であり、レー ザーストリッピングの開発研究を地道に進めてい く必要がある.

2. 素過程の物理

2.1 H⁻イオン, H⁰原子の電子結合エネルギー H⁻イオンの一つの電子は結合エネルギー 0.755 eV で水素原子に緩く結合している.

H⁰原子の基底状態の電子結合エネルギーは 13.6 eV で, 主量子数 n の励起状態の電子結合エ ネルギーは 13.6 n^{-2} eV である. したがって, 第 一 (n=2)及び第二 (n=3)励起状態の励起エネ ルギーはそれぞれ 10.2 eV, 12.1 eV である. また, レベルの幅はそれぞれ 4.1×10⁻⁷ eV, 1.2×10⁻⁷ eV である¹⁾.

2.2 H⁻ イオンの Photo-detachment 及び H⁰ 原子の励起と Photo-ionization

H⁻イオンの電子を剥離するためには 1.64 μ m より短い波長の光が必要である。H⁻イオンの Photo-detachmentの断面積の波長依存性を**図1** に示す。断面積は波長 800 nm 付近で 4×10⁻¹⁷ cm²の広いピークとなる²⁾.

基底状態にある電子を剥離するには 13.6 eV 以上のエネルギーが必要であるが、光で剥離する場合 91.1 nm より短い波長の光が必要である.第一, 第二励起状態にある電子を剥離するためには、それぞれ 3.4 eV, 1.5 eV 以上のエネルギーが必要であり、光の波長で言えばそれぞれ 363 nm, 823 nm より短い波長の光を吸収する必要がある. H⁰ 原子の基底状態及び低い励起状態の Photoionization の断面積の波長依存性を**図2**に示す²⁾.

基底状態にある H⁰ 原子を光の吸収で第一,第 二 励 起 状 態 に 励 起 す る 時, そ れ ぞ れ 波 長 121 nm, 102 nm の光が必要となる. 基底状態 から主量子数 n の励起状態への励起断面積は

$$\sigma_{1n} = \frac{\lambda^2}{2\pi} \frac{A_{n1}}{\Delta \omega_n}.$$
 (1)

図1 H⁻イオンの Photo-detachment 断面積の波長依存 性²⁾.



図2 H⁰ 原子の基底状態及び励起状態の Photo-ionization 断面積の波長依存性²⁾.

で与えられる. λ は光の波長, A_{n1} は励起状態の アインシュタイン係数, $\Delta \omega_n$ はレベル幅である.

2.3 Doppler 効果による光子のエネルギー変換 レーザービームを H⁻イオンまたは H⁰ 原子な どの粒子ビームに衝突させる時,粒子の静止系で のレーザービーム光子のエネルギーは Doppler 効果により実験室系での値とは異なった値とな る.速度 βc の粒子が実験室系でエネルギー E_{LF} の光子と衝突角 α で衝突する時,粒子の静止系で の光子のエネルギー E_{PRF} は Doppler 効果により 次のように書ける.

$$E_{PRF} = E_{LF} \gamma \left(1 + \beta \cos \alpha \right) \,. \tag{2}$$

ここで、 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$ である.

Doppler 効果により、 α を適切に選ぶと利用可能なレーザーを使って電子の剥離や励起に必要な エネルギーの光子を H⁻イオンや H⁰ 原子に衝突 させることが出来る.しかし、このような良いこ とばかりではなく、H⁻イオンや H⁰ 原子ビームが 運動量拡がり(速度 βc の拡がり)やベータート ロン振動に伴う角度の拡がりを持つため、H⁻イ オンや H⁰ 原子はレーザービームのエネルギー幅 より大きいエネルギー幅のレーザービームと衝突 することになる.ビーム粒子の運動量をpその誤 差を Δp , α の誤差を $\Delta \alpha$, E_{LF} の誤差を ΔE_{LF} , E_{PRF} の誤差を ΔE_{PRF} とすると式(2)より

$$\frac{\Delta E_{pRF}}{E_{pRF}} = \frac{\Delta E_{LF}}{E_{LF}} + \frac{\beta (\beta + \cos \alpha)}{1 + \beta \cos \alpha} \frac{\Delta p}{p} - \frac{\beta \sin \alpha}{1 + \beta \cos \alpha} \Delta \alpha \quad .$$
(3)

が得られる.この静止系でのエネルギー誤差が H⁻イオンや H⁰ 原子の電子の剥離や励起に求めら れるエネルギー幅に入る部分だけが有効に剥離や 励起を起こす.電子剥離では電子は基底状態や励 起状態から連続状態に励起されるので,この誤差 は問題にならない.しかし,レベル幅の狭い励起 状態への励起の場合は大きな問題が生じる.基底 状態にある H⁰ 原子の電子は結合エネルギーが高 く,一旦 n=2 または3の励起状態に励起した上 で剥離することが必要になるが,これらの励起状 態のエネルギー幅は 2.1 節で述べたように非常に 狭く,

$$\frac{\Delta E_n}{E_n} \le 10^{-8} \,. \tag{4}$$

である.ここで E_n は励起エネルギー、 ΔE_n はその幅である. Δp によって ΔE_{PRF} は変化し、それぞれの Δp に対して $E_{PRF}=E_n$ の周り $\Delta E_{PRF}/E_{PRF} \leq$

 10^{-8} が満たされる ΔE_{PRF} の部分しか励起に寄与しない. したがって、 Δp 全体を励起するために必要なレーザービームのパルスエネルギーは非常に高い値となる.

2.4 レーザービームの飽和エネルギー密度と 必要なエネルギー密度

粒子静止系での光子のエネルギーが E_{PRF} であるレーザービームによる H⁻イオンや H⁰ 原子の 電子剥離断面積または H⁰ 原子の励起状態への励 起断面積を σ とすると、レーザービームの飽和エ ネルギー密度は

$$\Phi_{PRF}^{S} = \frac{E_{PRF}}{\sigma}.$$
(5)

である. したがって実験室系での飽和エネルギー 密度 Φ_{IF}^{s} は,

$$\Phi_{LF}^{S} = \frac{E_{PRF}}{\sigma \gamma (1 + \beta \cos \alpha)^{2}} = \frac{E_{LF}}{\sigma (1 + \beta \cos \alpha)} \quad .$$
(6)

となる.

飽和エネルギー密度は、反応が必ず一度は起こ るようなレーザービームのエネルギー密度を与え る. この値を用いて、実際の粒子ビームとレーザー ビームの衝突の状況に合わせて必要なレーザー ビームのパルスエネルギーを決めることが出来 る.

 $H^- イ オ ン や 励 起 状 態 H^0 原 子 の Photo$ detachment の場合には励起される先の状態は連続状態であり、レーザービームのエネルギーがわずかに変化しても剥離断面積の変化はごくわずか $である. したがって、<math>H^- イオンや H^0$ 原子の運動 量拡がりに伴う Doppler 効果によりレーザービー ムエネルギーが変化しても剥離断面積は殆ど変化 せず、レーザーの飽和エネルギー密度は変わらな い.

H⁰原子を基底状態から n=2 や3の励起状態に 励起する場合,2.1 節に述べたように,励起状態 のレベル幅は極めて狭い.このため,H⁰原子ビー ムの運動量拡がりや角度の拡がりに伴う Doppler 効果によりレーザービームエネルギーは容易に励 起状態のレベル幅を超えて拡がる.レベル幅を外 れた光子は励起に寄与しないので、全ての H⁰ 原 子を励起するためには式(6)で与えられる飽和エ ネルギー密度より高いエネルギー密度が必要にな る.この場合には,必要なエネルギー密度 $\Phi_{LF}{}^{N}$ は, 式(1)の断面積を式(6)に代入して得られる $\Phi_{LF}{}^{s}$ を用いて,

$$\Phi_{LF}^{\ \ N} = \Phi_{LF}^{\ \ S} \times \frac{\Delta E_{PRF}}{\Delta E_n} \,. \tag{7}$$

となる.

2.5 粒子ビームとレーザービームの衝突での 相互作用時間

粒子ビームバンチの長さを τ_p とし,ビーム半 径を r_p とする.また,レーザービームパルスの 長さを τ_l とし,ビーム半径を r_l とする.これら のビームが図3に示すように衝突する時,粒子と レーザービームの相互作用時間 τ_i は,

$$\frac{2\sqrt{r_l^2 - r_p^2}}{\beta c \sin \alpha} \le \tau_i \le \frac{2r_l}{\beta c \sin \alpha}.$$
(8)

となる. cは光速である. レーザービームパルス長は

$$\tau_l \ge \tau_b + \tau_i. \tag{9}$$

とする必要がある. τ_i は粒子ビームとレーザー ビームの中心軸が作る面からの粒子までの距離に よって異なる. r_i は r_p よりわずかに大きいことが 望ましいが, この時 τ_i の平均値は $2r_i / \beta c \sin \alpha$ よりわずかに小さくなる. 必要なレーザーパルス



図3 粒子ビームバンチとレーザーパルスの衝突.

エネルギーを求めるためには τ_i をある値に決め る必要があるが、この値は粒子ビームとレーザー ビームの半径方向の密度分布から適切に設定する 必要がある.設定した τ_i に対して必要なレーザー パルスエネルギーは

$$E_l = \Phi_{LF}^N \times \pi r_l^2 \times \frac{\tau_l}{\tau_i}.$$
 (10)

となる.以下では、必要なレーザーパルスエネル ギーを求める時、粒子ビームとレーザービームの 中心軸が作る面内で粒子がレーザービームを通過 する時間を τ_i として使う.

2.6 外部磁場の Stark 効果による H⁻イオンや 励起 H⁰ 原子の電子剥離

速度 βc を持つ荷電粒子は外部磁場 B(T) に入ると Lorentz 力を受ける. この力は粒子の静止系では次式で表される電場 E(V/m)として作用する.

$$E = \beta \gamma c B \,. \tag{11}$$

400 MeV の H⁻イオンの場合この電場は1Tの磁 場中で3 MV/cm の強い電場となる.したがって, H⁻ビームが磁場の中に入ると,緩く結合してい る電子は磁場に応じた寿命で剥ぎ取られ H⁰ビー ムに変換される.電場 E 中での H⁻イオンの寿命 は

$$\tau = \frac{A_1}{E} \exp\left(\frac{A_2}{E}\right),$$

$$A_1 = 2.47 \times 10^{-6} \frac{Vs}{m}, \qquad A_2 = 4.49 \times 10^9 \frac{V}{m}.$$
(12)

と表される³⁾. 磁場の中で H⁻イオンは確率的に H⁰ 原子に変換されるので,ビームのエミッタン スは H⁻イオンの寿命とともに増加する. エミッ タンスの増加は出来るだけ小さいほうが良いが, 磁場は幾らでも強くする訳にも行かない. エミッ タンスの増加を許容出来る程度に抑えようとする と,寿命は 10⁻¹¹ sec 程度にする必要がある. 400 MeV の H⁻イオンの場合 B は 1.8 T となる.

図4に示すように、高速のH⁰原子の場合も磁 場中で受ける Stark 効果により各レベルはエネル



I S Reciprocal lifetime of n=3 states in the Stark Effect⁴⁾.

ギー幅が広がり電子が剥離される.励起状態の寿 命の逆数はレベル幅を角周波数で表した値であ り、レベル幅が広いほどその状態の電子の寿命は 短い.一例として、n=3の Stark 状態レベル幅が 電場とともにどのように変わるか図5に示す.こ の図から分かるように、 H^0 原子のn=3レベルの 寿命を 10^{-11} sec 程度にするには Stark 電場は 6 MV/cm 程度以上にする必要があり、400 MeV H^0 原子では2Tの磁場を通す必要がある.

H^o ビームの運動量拡がりをカヴァーす るための対策

通常 H⁻ビームの運動量拡がりは $\Delta p/p \approx \pm 10^{-3}$ である. これと衝突するレーザービームの光子エ



☑ 6 Frequency Sweeping Method.

ネルギーは粒子の静止系で式(3)にしたがって大幅に広がるので、H⁰原子の励起状態のレベル幅よりはるかに広くなる.このため、レーザービームでH⁰原子を n=2 または n=3 などの励起状態に励起する時その効率は非常に悪くなり、ほとんどのH⁰原子は励起されない.これを避けるために何らかの工夫が必要になる.これまでこのような工夫として以下の三つの方法が提案されている.

- 1) Frequency Sweeping Method
- 2) Dispersion Tailoring Method
- 3) Level Broadening Method

3.1 Frequency Sweeping Method⁵⁾

Frequency Sweeping Method では**図**6に示す ように,角度の拡がりを持たせたレーザービーム を H⁰ビームに衝突させる.すべての $\Delta p/p$ に対 して,次式が成り立つ $\Delta \alpha$ が存在するように $\Delta \alpha$ を設定する.

$$\left(\beta + \cos\alpha\right) \frac{\Delta p}{p} - \left(\sin\alpha\right) \Delta \alpha = 0.$$
 (13)

角度の拡がりΔαが適切であれば、すべてのH⁰ 原子はレーザービームの中のどこかの角度で光子 と反応し励起される.ただこの方法では、一つの H⁰原子はレーザービームの中の非常に狭い範囲 の角度の光子としか反応できないので、すべての H⁰原子を励起するためには強度の非常に高い レーザービームが必要である.

3.2 Dispersion Tailoring Method⁵⁾

Dispersion Tailoring Method では**図7**に示す ように、入射 H⁻ビームを Dispersion Derivative のある磁場を通し、H⁰ 原子が $\Delta p/p$ に比例した角 度の誤差 $\Delta \alpha'$ を持つようなビームを形成した後 レーザービームと衝突させる.



☑ 7 Dispersion Tailoring Method.

Dispersion Derivative \mathcal{E}

$$D' = \frac{\beta + \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$
 (14)

とすると、運動量誤差が $\Delta p/p$ の H^0 原子は

$$\Delta \alpha' = D' \frac{\Delta p}{p} = \frac{\beta + \cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\Delta p}{p}.$$
 (15)

の角度誤差を生じる. これを式(3)のΔαに加え ると,

$$\frac{\Delta E_{PRF}}{E_{PRF}} = \frac{\Delta E_{LF}}{E_{LF}} - \frac{\beta \sin \alpha}{1 + \beta \cos \alpha} \Delta \alpha.$$
(16)

が得られ、運動量拡がりによるレーザービームの エネルギー拡がりが消去できる.この方法では必 要なレーザービームのパルスエネルギーが大幅に 軽減されるが、全ての H⁰ 原子はただ一つの角度 のレーザービームとのみ衝突するので、 Dispersion Derivative の値やレーザービームの 衝突角などの精度や安定度に対する要求は厳しく なる.

3.3 Level Broadening Method⁶⁾

図8 (a) に Level Broadening Method の概念 図を示す. 高エネルギーの H⁻ビームはレーザー ビームと衝突し, 電子を剥ぎ取られ H⁰ビームに 変換される. H⁰ビームへの変換には H⁻ビームの エネルギーが 1 GeV 程度以上であれば, レーザー ビームとの衝突の代わりに磁場による Lorentz



(b) Laser stripping via a broad Stark stateImage: Image 8 Revel Broadening Method.

stripping を使うことも可能である. H⁰ビームは ヘルムホルツコイルにより発生される磁場の中に 導かれ Stark 効果を受ける. この Stark 効果によ り図8 (b) に示すように, H⁰原子の各レベルは エネルギー幅が広がる. Level Broadening Method では, n=3のレベル幅がH⁰ビームの運 動量拡がりによるレーザービームのエネルギー幅 の拡がりをカヴァーする程度に広がるような磁場 の中で, H⁰原子をn=1の状態からn=3の状態 に励起する. 励起された H⁰原子のレベル幅は広 いので十分速く陽子と電子に崩壊し, 形成される pビームのエミッタンス増加はわずかに抑えられ る.

 J-PARC RCS にレーザーストリッピング を適用する時の課題と対策

4.1 400 MeV H⁻イオン,励起 H⁰ 原子の電子 剥離

これまで述べてきた素過程の物理を勘案して, J-PARC RCS での磁場とレーザーによる荷電変換 入射の方法を検討する.入射 H⁻ビームのエネル ギーは 400 MeV であるから, β =0.713, γ =1.426 である.2.5節で述べたように,このエネルギー では H⁻イオンの電子を剥離するためには 1.8 T 以上の磁場が必要である.また n=3 励起状態 H⁰ 原子の電子を剥離するためには 2 T 以上の磁場が 必要である. J-PARC RCS 入射点はビームペイン ティングのために大きなアパーチャーが必要であ り,磁石の磁極間隙は20 cm 程度になる. この 磁極間隙で2 T の磁場を発生するためにはかなり 大きな電磁石が必要となり,ビーム入射のための 機器で込み合っている入射点にこの磁石を挿入す ることは無理がある. したがって,磁場の使用は 諦めてレーザーによる剥離を検討する.

図9に示すように400 MeVのH⁻ビームまた は、H⁰ビームと波長1,064 nmのNd:YAGレー ザーとを90度の角度で衝突させると、Doppler 効果により粒子の静止系では波長は749 nm に変 換される. この波長でのH⁻イオンの電子剥離断 面積は図1より最大値の4×10⁻¹⁷ cm²となる. また、図2より n=3 励起H⁰原子の電子剥離断面 積も1.5×10⁻¹⁷ cm²となる. Nd:YAGレーザー は入手が比較的容易で大強度のレーザービームが 得られるレーザーであり、このレーザーにより電 子剥離を行うことが可能かどうか検討する.

J-PARC RCS の 400 MeV H⁻ビームのマイクロ バンチは、横方向のエミッタンスが 4 π µmrad, 縦方向のエミッタンスが 3.5 eVs とされている. ここでは、マイクロバンチの半径が r_p =2 mm, バンチ長さが τ_p =30ps として必要なNd:YAG レー ザーのパルスエネルギーを見積もる. 衝突角 α = 90 deg とすると相互作用時間は τ_i =23.4 ps とな る. H⁻イオンの電子剥離に必要なレーザーパル スエネルギー密度は式 (6) より 4.7 mJ/cm² であ る. レーザーパルス長は式(9)より τ_l =53.4 ps 以 上必要であり,レーザービーム半径を η =2.5 mm とすると必要なパルスエネルギーは 2.1 mJ となる. n=3 励起状態 H⁰ 原子の電子剥離につい ても同様にして,必要なレーザーパルスエネル ギー密度は 12.4 mJ/cm²,パルスエネルギーは 5.6 mJ となる.

4.2 H⁰ 原子の *n*=1 から *n*=3 への励起

H⁰ 原子の n=3 励起状態の励起エネルギーは 12.1 eV であり、励起に必要な光の波長は 102 nm である。400 MeV H⁰ ビームの実験室系 では、**図9**に示すように 172 nm の Xe エキシマ レーザー (光子エネルギー 7.21 eV) を*α*=75.3 degの角度で衝突させれば良い. RCS入射H⁻ビー ムのエネルギースプレッドΔTは90%で 0.697 MeV, 99%では 1.31 MeV とされている. これよりH⁰ビームの運動量拡がりを求めると, $\Delta p/p = (\gamma / (1+\gamma)) \Delta T/T \downarrow b$, $\Delta p/p = 1.02 \times 10^{-3}$ (90%), 1.93×10⁻³ (99%) である. 式(3)より. △*p/p*に伴うレーザービーム光子のエネルギー拡 β^{ς} b is $\Delta E_{PRF}/E_{PRF} = \{\beta(\beta + \cos \alpha)/(1 + \beta \cos \alpha)\}$ $(\Delta p/p)$ である. E_{PRF} =12.1 eVであるので、 ΔE_{PRF} $=7.2 \times 10^{-3} \text{ eV} (90\%), 1.36 \times 10^{-3} \text{ eV} (99\%)$ となる. レベル幅は $\Delta E_3 = 1.2 \times 10^{-7}$ eV と極め て狭いので、2.4節で述べたように必要なレー ザーパルスエネルギー密度を式(7)により求める と 4.0 mJ/cm^2 (90%), 7.4 mJ/cm² (99%) とな る. また、レーザービームの半径をn = 2.5 mm



図9 400 MeV H⁰ に対する Doppler 効果.

とすると、相互作用時間は τ_i =24.2 ps、必要なパルス長は τ_l =54.2 psとなり、パルスエネルギーは 1.8 mJ (90%)、3.3 mJ (99%)となる.

また,運動量拡がりを Frequency Sweeping Method でカヴァーするためには,このパルスエ ネルギーのレーザービームに式 (13) で与えら れる角度の拡がり $\Delta \alpha = 1.0 \text{ mrad } (90\%)$,または 1.93 mrad (99%) を持たせて H⁰ ビームと衝突 させる必要がある.

ここでは波長 172 nm の Xe エキシマレーザー を用いる場合を紹介したが、193 nm の ArF エキ シマレーザーでも可能である.いずれにしても、 エキシマレーザーが必要となるがこれは H⁰ 原子 の *n*=3 レベルのエネルギーが高いためである. エキシマレーザーは、通常装置が大型となりがち なこと、光子エネルギーが高いため共振器のミ ラーを傷付けやすい、等の問題がある.これらの 問題を解決し次に述べるレーザー蓄積リングに挿 入できるエキシマレーザー増幅器を開発すること が必要である.

4.3 繰り返し 324 MHz でレーザービームを供 給する方法

これまでの議論は、H⁻ビーム一つのマイクロ バンチをレーザーパルスによって荷電変換する場 合の検討であった.実際の加速器では、H⁻ビー ムは 324 MHz で繰り返されるマイクロバンチが 500 µsec 継続するマクロパルスとして、25 Hz の繰り返しで入射される. したがって, 4.1 節, 4.2 節で求めたパルスエネルギーのレーザーパルスを 324 MHz で供給しなくてはならない. 通常のレー ザーでは、共振器から取り出したレーザービーム を衝突点に導き一度使用したビームは捨てられて しまう. 数 mJ, 324 MHz のレーザーパルスを 500 µsec のマクロパルスとして 25 Hz で照射す る時平均ビーム強度は数十kWとなる.数mJの レーザーパルスを 324 MHz で発生させることは 非常に大変であるが、このビームを一度使ったき りで捨ててしまうのもあまりにももったいない. そこで, レーザーパルスを繰り返し H⁻(H⁰) ビー ムバンチとの衝突点に戻して利用するリング共振 器を考案した、このリング共振器では、レーザー パルスは 324 MHz で周回するため周長は 92 cm 程度となる、レーザーパルスはミラー等でロスす るので、周回毎のロスを補うための増幅器を挿入

する. レーザーパルスは周回毎に粒子ビームバン チと衝突するが、そのためにはレーザーパルスの 横方向のオプティックスが一定である必要があ る. 更に、H⁰ビームバンチの運動量拡がりをカ ヴァーするため衝突するレーザービームに決まっ た角度Δαを持たせる必要がある. これらの要請 を満たすリング共振器としてレーザー蓄積リング を次章で少し詳しく説明する.

5. Nd:YAG レーザー蓄積リング

5.1 レーザー蓄積リング⁷⁾

トロイダルミラーは平面鏡の偏向機能とレンズ の収束機能を併せ持った光学素子である.メリ ディオナルプレーン(偏向面)内の曲率半径を R_h サジタルプレーン(偏向面に垂直な面)内の 曲率半径を R_v とし、レーザービームの入射角を α とすると、偏向面内の焦点距離 f_h それに垂直 な方向の焦点距離 f_v は

$$f_h = (R_h \cos \alpha)/2$$
, $f_v = R_v/(2 \cos \alpha)$ (17)

となる. したがって, $R_v = R_h \cos^2 \alpha$ とすれば, $f_h = f_v = f$ となる. レーザービームがガウシアンビー ムの時は, 図 10 に示すようにミラーの上流fの 距離 (*a*) にウエストを形成してビームを入射す れば, 反射されたビームはミラーの下流 f の位置 (*a*') にウエストを結ぶ. この時, *a* のウエスト の $1/e^2$ 半径を *w*, *a*' のウエストの $1/e^2$ 半径を *w*' とすると

$$ww' = \lambda f / \pi \tag{18}$$

である.また、ウエストの $1/e^2$ 半径wとウエスト前後のビームの拡がりを θ とすると

$$w\theta = \lambda / \pi \tag{19}$$

となる.

αを45°とし、トロイダルミラーの上流か下流 のどちらかに平面鏡を挿入したものを二組用意 し、焦点が重なるように配置すれば、図11のよ うに長方形のリングが形成される. このリングに PM1 と TR1 の間の光路の延長線上 TR1 から焦 点距離の位置 LW にウエストを形成してシード レーザーを入射すると、TR1 で反射したビーム は a 点にウエストを形成する. その後 PM2, TR2 で反射したビームは c_0 でウエストを形成し, 以後 a, c_0 でウエストを形成しながらリングを周 回する. トロイダルミラーの曲率半径を R_h = 65.0 cm, R_v =32.5 cm, とすればf=23.0 cm と なり、周長は 92.0 cm となってレーザービーム は 324 MHz で周回する. また、LW におけるシー ドレーザーのウエストのビームサイズを調整する ことにより、a (または、 c_0) 点での $w や \theta を$ コ ントロールできる.

このリングに、図12に示すように、粒子ビー ムとの衝突点(Interaction Point)と、レーザー ビームがリングを周回する間に起こるビームロス を補うための増幅器(Laser Amplifier)を装備し たものがレーザー蓄積リングである.図12では ウエストの位置に衝突点と増幅器を置くように描いてあるが、これらの位置はウエストでなくてもよい.このようなリングに、レーザーストリッピングに必要なパルス長のシードレーザーパルスを入射し、増幅器で必要なパルスエネルギーに増幅するとともに、リング周回に伴うビームロスを補って 500 µsec の間維持し、衝突点で H⁻ (H⁰) ビームバンチに衝突させる.

5.2 半導体レーザー増幅器

4.1 節に述べたように、Nd:YAG レーザーによ り H⁻ (H⁰) ビームの電子剥離を行う場合 5 mJ 程度のレーザーパルスエネルギーが必要になる. リング周回のロスを Nd:YAG ロッドの半導体レー ザーサイドポンピングによる増幅器で補う場合を 検討する. レーザービームのリング周回に伴うロ スには、ミラーによるロスのほか Nd:YAG ロッ









図 13 半導体レーザースタックアレイサイドポンピング (東芝の例⁸⁾).

ド通過に伴うロスがある. 一周あたりのロスが 2%であるとすれば、増幅器は一周あたり 100 μJ を補う必要がある. 100 µJ を 324 MHz で補うと 32.4 kW となる。半導体レーザーサイドポンピン グでの電力からレーザーへの変換効率が30%程 度であるとすると、必要な増幅器のピークパワー は100 kW 程度となる. レーザー発振に関わる Nd³⁺イオン上位レベルの放射寿命は~400 µsec と長いがレーザーパルスが約3 nsec の周期で通 過するので、このパワーをH⁻(H⁰)ビームマク ロパルスの間 500 usec 連続的にポンプする. マ クロパルスは 25 Hz で繰り返されるので平均の パワーは 1.25 kW となる. このようなハイパワー のポンピングを行った試みはいくつか報告されて いる⁸⁻¹¹⁾. 図 13 は東芝レヴューに報告されてい る半導体レーザーサイドポンピングの例である.

Nd:YAG ロッドの屈折率は 1.8 と非常に大きい のでその配置は光路長の変化を十分考慮して決め る必要がある.リングの対称性を崩さないために は、二つのトロイダルミラーの上流側か下流側の どちらかに同じ長さの Nd:YAG ロッドを挿入す る方法がある.

6. Xe $\pm + \cdot = - \cdot = 12^{-12}$

6.1 エキシマーの放射寿命と細管エキシマ レーザーのアイデア

エキシマレーザーの発振に寄与する高位レベル の放射寿命は4nsecとされている.このためレー ザー発振に必要な反転分布を維持するためには, MW/cm³オーダーのパワーをレーザーガスの発 振領域に注入しなければならない. このパワーを 500 μsec のマクロパルスとして 25 Hz の繰り返 しで注入すると平均で数十 kW となる.

エキシマレーザーの開発を目指し勉強を始めた ころはこのことを知らず、最初、細管エキシマラ ンプを応用して細管エキシマレーザーが出来ない か検討した. 細管エキシマランプは直径 10 mm 程度の石英ガラス管に希ガスやハロゲンと希ガス の混合ガスを詰め両端を封じたものであり、高周 波電圧により放電させ発生するエキシマ光を利用 する. 長さ 20 ~ 30 cm のランプでエキシマレー ザーを発振出来れば、レーザー蓄積リングに挿入 してエキシマレーザーの増幅器として使える. ガ スレーザーには He-Ne レーザーや Ar レーザー など形状が類似したレーザーがある. このランプ にX線で予備電離を行いガス中に高密度電子を 発生させた上で、高周波電圧をかけて高密度の放 電を起こさせレーザー発振を実現することを考え た. 更に, 高周波電圧と垂直に磁場を掛けること で ECR プラズマを発生させれば、比較的低いガ ス圧で高密度のエキシマーの反転分布を形成させ ることが出来るのではないかと考えたのである. しかし暫くして、エキシマレーザーの発振に寄与 する高位レベルの放射寿命は数 nsec であり、必 要なレーザービームを発生するために平均でも数 + kW もの電力を放電領域に注入することが必要 であることがわかった. 石英ガラスのレーザーガ ス細管は管内で発生する熱を外に取り出し処理す ることが難しい. このため, 細管エキシマレーザー を用いた増幅器の実現には、除熱という大きな技 術的な課題の克服が必須となる.

6.2 電子ビーム励起 Xe エキシマレーザー

エキシマレーザー装置には、放電励起方式と電 子ビーム励起方式がある¹²⁾.細管エキシマレー ザーのアイデアに次いで、電子ビーム励起Xeエ キシマレーザーを用いるアイデアについて検討し た.電子ビーム励起Xeエキシマレーザーでは、 ハロゲンガスを必要とせず希ガスのみを使うの で、加速器の現場で使う上で取り扱いが容易であ ると考えられる.レーザーストリッピングへの応 用では、これまでのnsecオーダーのパルス長で Jオーダーのハイパワーレーザーを出力する利用 形態と異なり、500 µsec とパルスの継続時間が 長いが必要なピークパルスエネルギーは mJ オー ダーで低い. このようなレーザー発振では,ショー トパルスのハイパワーレーザーに見られる共振器 ミラーへのダメージは軽減されるのではないかと 考えられる. このようなことから, さらなる開発 の余地があると期待される.

4.2 節で述べたように、400 MeV H⁰ 原子を基 底状態(n=1)から n=3 励起状態へ励起するた めに 172 nm の Xe エキシマレーザーを用いる場 合,必要なレーザーパルスエネルギーは3mJ程 度である. このレーザーパルスを 324 MHz で利 用するために、5.1節に記したレーザー蓄積リン グを用いることを検討する. 172 nm レーザーの ミラーによるロスは大きく、周回毎に20%程度 のロスがあるとすると 600 µJ エネルギーを補う 必要がある. レーザーガスに注入された電子ビー ムのエネルギーの殆どはエキシマー生成に寄与 し、その10%程度がレーザーエネルギーに変換 されると言われている¹²⁾. したがって, レーザー ビームの占める部分に注入される必要のあるエネ ルギーは6mJになる. レーザービームの半径は 2.5 mm と仮定されているので 30 mJ/cm² であ り、これを 324 MHz で繰り返すのでそのエネル ギー密度は約10 MW/cm²となる. レーザーガス のポンピング領域の形状を1 cm×1 cm×20 cm とすると 0.5 MW/cm^3 となる. また, Xe エキシ マーの放射寿命は4 nsec 程度とされており、急 速に減少するので注入すべきエネルギー密度はも

う少し高いと考えられる. このエネルギーを注入 するために,電子ビームダイオードを用いて数百 keV-100 A 程度の電子ビームを Ti やカプトン の薄膜を張った 1 cm×20 cm の窓から注入する. このようなエキシマレーザーを実現することを目 指し開発研究を進める必要がある.

参考文献

- 1) K. Omidvar, Atomic Data and Nuclear Data Tables **28**, 1-20 (1983).
- L. M. Branscomb, "Physics of the One-And-Two-Electron Atoms", edited by F. Bopp and H. Kleinpoppen, North-Holland, (1968).
- A. J. Jason, D. W. Hudgings and O. B. van Dyck, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. NS-28, No. 3, June (1981).
- 4) D. S. Bailey, J. R. Hiskes and A. C. Riviere, Nuclear Fusion 5 (1965).
- 5) V. Danilov et al., PRST-AB, **10**, 053501 (2007).
- 6) T. Bergeman et al., Phys. Rev. Letters, Vol. 53, No. 8, 775-778 (1984).
- 7) 山根 功,「加速器」Vol. 10, No. 1, 20-31 (2013).
- 8) 秋山靖裕, 湯浅広土, 東芝レヴュー Vol. 57, No. 4, 51-55 (2002).
- 9) 西前順一, レーザー研究 第31巻第8号, 530-534 (2003).
- 10) 川嶋利幸 他, レーザー研究 第34巻第9号, 621-627 (2006).
- 11) 菅博文 他, レーザー研究 第36巻第5号, 268-272 (2008).
- 12) 前田三男編, エキシマーレーザー, 日本分光学会 測定法シリーズ 27, 学会出版センター (1993).